

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第2区分

【発行日】平成17年6月2日(2005.6.2)

【公開番号】特開2004-137258(P2004-137258A)

【公開日】平成16年5月13日(2004.5.13)

【年通号数】公開・登録公報2004-018

【出願番号】特願2003-304412(P2003-304412)

【国際特許分類第7版】

C 0 7 C 309/65

C 0 7 C 1/26

C 0 7 C 1/32

C 0 7 C 25/13

C 0 7 C 39/40

C 0 7 C 41/30

C 0 7 C 43/225

C 0 7 C 43/23

// C 0 7 B 61/00

C 0 9 K 19/32

【F I】

C 0 7 C 309/65

C 0 7 C 1/26

C 0 7 C 1/32

C 0 7 C 25/13

C 0 7 C 39/40

C 0 7 C 41/30

C 0 7 C 43/225 C

C 0 7 C 43/23 E

C 0 7 B 61/00 3 0 0

C 0 9 K 19/32

【手続補正書】

【提出日】平成16年10月18日(2004.10.18)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

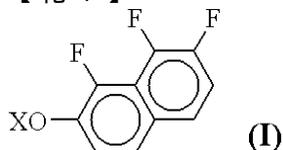
【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

一般式(1)

【化1】



(式中、Xは水素原子、CF₃SO₂-または炭素数1～10の飽和または不飽和のアルキル基を表す。)で表される化合物。

【請求項2】

Xが水素原子を表す請求項1記載の化合物。

【請求項 3】

XがCF₃SO₂-を表す請求項1記載の化合物。

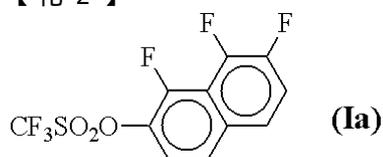
【請求項 4】

Xが炭素数1～10の飽和または不飽和のアルキル基を表す請求項1記載の化合物。

【請求項 5】

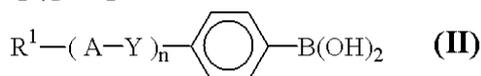
式(1a)

【化 2】



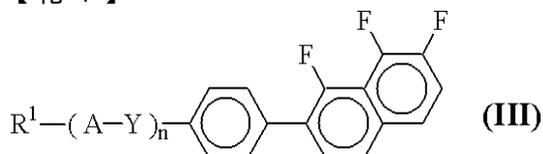
で表される化合物に、一般式(II)

【化 3】



(式中、R¹は炭素数1～10の飽和または不飽和のアルキル基を表し、Yは単結合、-CH₂C
H₂-または-CH₂O-を表し、Aはトランス-1,4-シクロヘキシレン基又は1,4-フェニレン基を
表し、nは0または1を表す。)で表される化合物を触媒存在下に反応させることによる
一般式(III)

【化 4】

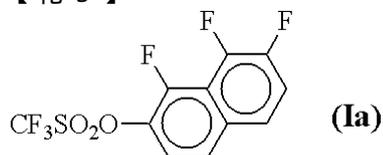


(式中、R¹、Y、Aおよびnは一般式(II)におけるR¹、Y、Aおよびnと同じ意味を表す。)
で表される化合物の製造方法。

【請求項 6】

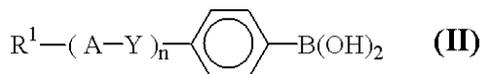
式(1a)

【化 5】



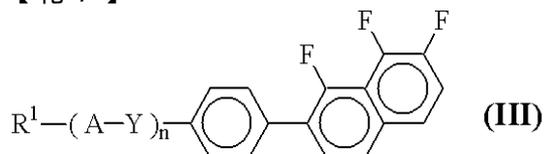
で表される化合物に、一般式(II)

【化 6】



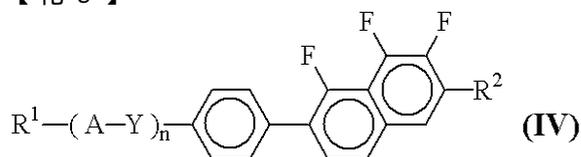
(式中、R¹は炭素数1～10の飽和または不飽和のアルキル基を表し、Yは単結合、-CH₂C
H₂-または-CH₂O-を表し、Aはトランス-1,4-シクロヘキシレン基又は1,4-フェニレン基を
表し、nは0または1を表す。)で表される化合物を触媒存在下に反応させることにより
一般式(III)

【化 7】



(式中、 R^1 、 Y 、 A および n は一般式(II)における R^1 、 Y 、 A および n と同じ意味を表す。)で表される化合物を得た後、これをアルキル化またはアルコキシル化することを特徴とする一般式(IV)

【化 8】

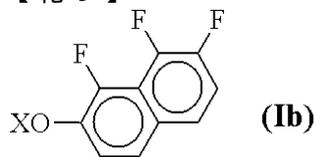


(式中、 R^1 、 Y 、 A および n は一般式(II)における R^1 、 Y 、 A および n と同じ意味を表し、 R^2 は炭素数1~10の飽和または不飽和のアルキル基またはアルコキシル基を表す。)で表される化合物の製造方法。

【請求項 7】

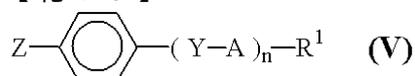
一般式(Ib)

【化 9】



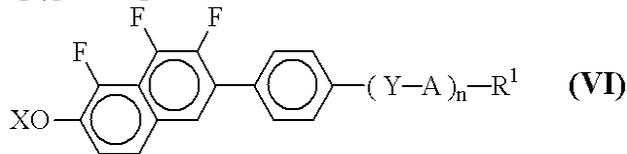
(式中、 X は炭素数1~10の飽和または不飽和のアルキル基を表す。)で表される化合物の6位をリチオ化し、トリメトキシボランを作用させ、得られたボロン酸に、一般式(V)

【化 10】



(式中、 Z はヨウ素原子、臭素原子、塩素原子またはトリフルオロメタンシルホニルオキシ基を表し、 R^1 は炭素数1~10の飽和または不飽和のアルキル基を表し、 Y は単結合、 $-\text{CH}_2\text{CH}_2-$ または $-\text{CH}_2\text{O}-$ を表し、 A はトランス-1,4-シクロヘキシレン基又は1,4-フェニレン基を表し、 n は0または1を表す。)で表される化合物を触媒存在下に反応させることを特徴とする、一般式(VI)

【化 11】

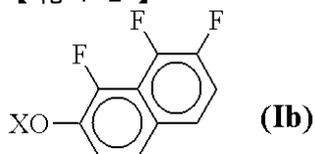


(式中、 X および R^1 は炭素数1~10の飽和または不飽和のアルキル基を表し、 Y は単結合、 $-\text{CH}_2\text{CH}_2-$ または $-\text{CH}_2\text{O}-$ を表し、 A はトランス-1,4-シクロヘキシレン基又は1,4-フェニレン基を表し、 n は0または1を表す。)で表される化合物の製造方法。

【請求項 8】

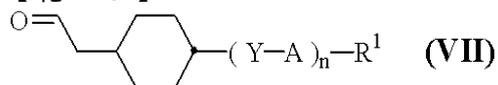
一般式(Ib)

【化 1 2】



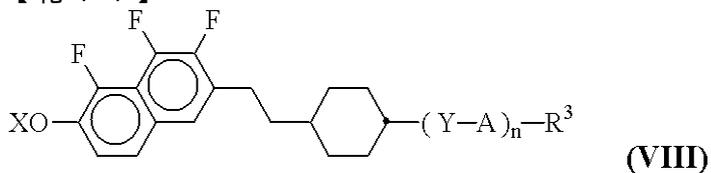
(式中、Xは炭素数1～10の飽和または不飽和のアルキル基を表す。)で表される化合物の6位をリチオ化し、一般式(VII)

【化 1 3】



(式中、R¹は炭素数1～10の飽和または不飽和のアルキル基を表し、Yは単結合、-CH₂CH₂-または-CH₂O-を表し、Aはトランス-1,4-シクロヘキシレン基又は1,4-フェニレン基を表し、nは0または1を表す。)で表されるシクロヘキシルアセトアルデヒド誘導体を反応させた後、脱水し生成する二重結合を水素添加することによる、一般式(VIII)

【化 1 4】



(式中、XおよびR³は炭素数1～10の飽和アルキル基を表し、Yは単結合、-CH₂CH₂-または-CH₂O-を表し、Aはトランス-1,4-シクロヘキシレン基又は1,4-フェニレン基を表し、nは0または1を表す。)で表される化合物の製造方法。